

- [7] Portis A.M., Blazey K.W., Müller K.A., Bednorz J.G. // *Europhys. Lett.* 1988. V. 5. N 5. P. 467-472.
- [8] Blazey K.W., Portis A.M., Bednorz L.G. // *Solid State Commun.* 1988. V. 65. N 10. P. 1153-1156.
- [9] Богачев С.В., Косогов А.О., Татарченко В.А., Третьяков В.И. // *Письма в ЖЭТФ*. 1988. Т. 47. В. 3. С. 166-168.
- [10] Rakulis E.J., Osada T. // *Phys. Rev. B*. 1988. V. 37. N 10. P. 5940-5942.
- [11] Абрамов О.В., Левиев Г.И., Погодсов В.Г., Трунин М.Р. // *Письма в ЖЭТФ*. 1987. Т. 46. В. 11. С. 433-435.

Институт физики  
АН Грузинской ССР,  
Тбилиси

Поступило в Редакцию  
16 июня 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 4  
11

26 февраля 1990 г.

© 1990

## ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ СУММ НЕЙТРАЛЬНЫХ И ИОННЫХ СОСТОЯНИЙ МНОГОАТОМНЫХ ЧАСТИЦ

Н.М. Блашенков, Г.Я. Лаврентьев

Метод поверхностной ионизации многоатомных частиц в умеренных электрических полях оказался весьма информативным [1]. В данной работе изучалась поверхностная ионизация антрацена и висмута в электрических полях напряженностью от  $9 \cdot 10^5$  В/см до  $4.5 \cdot 10^6$  В/см. Зависимость плотности ионного тока  $J$  с поверхности от напряженности  $F$  электрического поля и температуры поверхности  $T$  при неактивированной адсорбции дается следующим выражением [2]:

$$j = \frac{e\nu}{1 + \frac{Q^0}{Q^+} \exp \frac{e(V - \varphi - \sqrt{eF})}{kT}}, \quad (1)$$

где  $\nu$  – плотность потока нейтральных частиц, падающих на поверхность;  $Q^0$ ;  $Q^+$  – полные статистические суммы иона и нейтральной частицы соответственно;  $e$  – заряд электрона;  $\varphi$  – работа выхода эмиттера;  $V$  – потенциал ионизации частиц;  $k$  – постоянная Больцмана. Для многоатомных частиц полные статисти-

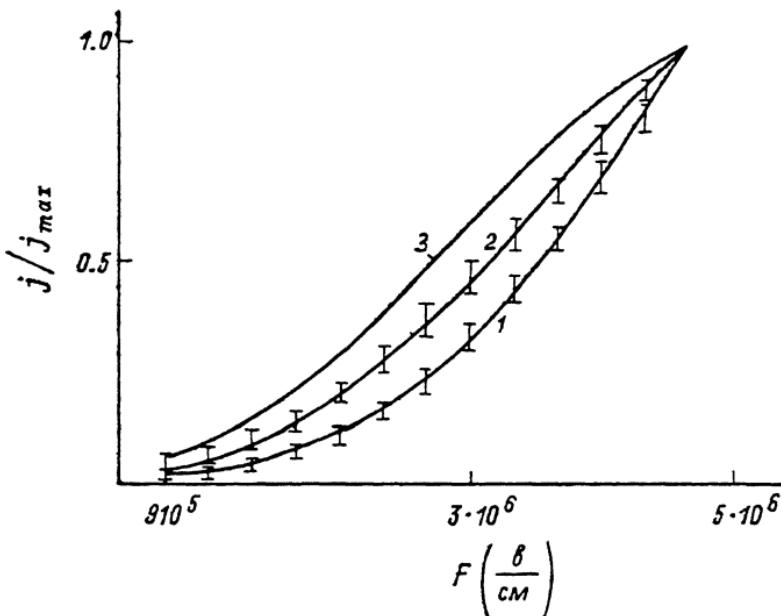
ческие суммы в первом приближении можно представить как произведения статистических сумм по каждому виду движения  $Q = Q_n Q_{\delta p} Q_k Q_3$  [3], где  $Q_n, Q_{\delta p}, Q_k, Q_3$  – статистические суммы поступательного, вращательного, колебательного и электронного состояний частицы. Отношение статистических сумм для многоатомных частиц записывается в виде:

$$\frac{Q^0}{Q^+} = \frac{Q_k^0 Q_3^0}{Q_k^+ Q_3^+}. \quad (2)$$

$Q_n^0$  и  $Q_n^+$  в (2) сократились, т.к. массы иона и нейтральной частицы практически равны, а поскольку при ионизации и конформация молекулы антрацена не изменяется,  $Q_{\delta p}^0$  и  $Q_{\delta p}^+$  тоже сокращаются.

Как видно из (1), и (2) изучение зависимости ионного тока от напряженности электрического поля при известных значениях  $V$ ,  $\varphi$  и  $F$  позволяет определять величину отношения статистических сумм, что особенно интересно для многоатомных частиц. В опытах в качестве эмиттера была взята окисленная вольфрамовая нить диаметром 10 мкм, окруженная коаксиальным цилиндром. Между цилиндром и нитью прикладывалась ускоряющая положительные ионы разность потенциалов, создающая напряженность электрического поля на поверхности в диапазоне  $(9 \cdot 10^5 - 4.5 \cdot 10^6)$  В/см. Ионы, образовавшиеся на поверхности эмиттера, фокусировались системой линз полевого источника [4] на входную щель секторного  $60^\circ$  масс-спектрометра [1]. Температура эмиттера составляла  $(1100 \pm 20)$  К. Давление паров антрацена по ионизационному манометру было  $2 \cdot 10^{-7}$  Тор. Работа выхода эмиттера определялась по температурной зависимости тока ионов  $B_i^+$  при минимальной напряженности поля  $9 \cdot 10^5$  В/см и составляла  $(6.57 \pm 0.05)$  эВ. На рисунке представлены зависимости токов ионов  $B_i^+$  (точки на кривой 1) и антрацена (точки на кривой 2) от напряженности электрического поля. Непрерывная линия (кривая 1) – результат машинного расчета по формуле (1) для  $B_i^+$ , параметры кривой:  $T = 1100$  К,  $\varphi = 6.60$  эВ,  $V = 7.286$  эВ [5].

Отношение статистических сумм  $Q^0/Q^+$  для  $B_i^+$  было взято равным 4, т.к. основное состояние атома  $B_i^+ - ^4S_{3/2}$  [5] (орбитальное квантовое число  $L=0$ , полный спин  $S=3/2$ , полный момент  $J=3/2$ ). Поскольку  $L=0$ , тонкого расщепления нет, но уровень вырожден по направлению полного момента  $J$ . Степень вырождения  $2J+1$  равна 4, таким образом мультиплетность основного состояния атома висмута равна 4. Энергия перехода в первое возбужденное состояние составляет 4 эВ [5]. Очевидно, что вероятность его термического возбуждения практически равна 0. Мультиплетность иона  $B_i^+$  равна 1, поскольку основное состояние иона  $^3P_0$  [5] ( $L=1, \beta=1, J=0$ ). В данном случае имеет место тонкое расщепление уровней, кратность которого равна 3 ( $2L+1$ , либо  $2\beta+1$ ). Таким образом, возникают три уровня, отличающиеся



значением полного момента  $J$ , эти уровни с  $J=2, 1, 0$ . В основном состоянии иона  $J=0$ , энергия возбуждения из этого состояния в ближайшее ( $J=1$ ) составляет 1.65 эВ [5]. Вероятность его за-селения при температуре 1100 К составляет величину порядка  $10^{-7}$ , поэтому в статсумме ее можно не учитывать. Вырождения же на направление момента нет, т.к.  $J=0$ , следовательно, отношение статистических сумм для  $B^i Q^0/Q^+ = 4$ . На рис. 1 видно хорошее совпадение теоретической кривой с экспериментом. Надо отметить, что для лучшего совпадения теоретической кривой с эксперимен-тальными точками производилось варьирование значения работы вы-хода в пределах ошибки измерения  $\varphi$  при фиксированном значении  $Q^0/Q^+$ . В результате наилучшее совпадение получилось при  $\varphi = -(6.60 \pm 0.2)$  эВ. Кривая 2 – результат машинного расчета ионно-го тока антрацена со следующими параметрами:  $T=1100$  К,  $V=-7.38$  эВ [6],  $\varphi=6.60$  цВ. Отношение статсумм варьировалось до наилучшего совпадения теоретической кривой с эксперимен-тальными точками. В результате наилучшее совпадение получилось при  $Q^0/Q^+ = 0.50 \pm 0.04$ . Кривая 3 рассчитана для антрацена при отно-шении статсумм  $1/4$ , она иллюстрирует чувствительность методики определения отношения статсумм. Как видно из (2), это отношение состоит из двух сомножителей – отношения статсумм электронных состояний и отношения статсумм колебательных состояний ней-тральной частицы и иона. В работе [7] показано, что все орбита-ли молекулы антрацена заполнены полностью, мультиплетность ос-новного состояния равна 1. Там же показано, что на верхней ор-битали молекулы антрацена находятся два электрона, поэтому изъ-ятие одного из них приводит к ионному состоянию со спином  $\beta=1/2$ .

и мультиплетностью  $2J+1=2$ , а т.к. для многоатомных молекул не имеет места закон сохранения орбитального момента, мультиплетность ионного состояния будет определяться только спиновой мультиплетностью, поэтому отношение  $Q^0/Q^+ = 1/2$ , что совпадает с экспериментом. Что касается колебательного спектра, то для иона нафталина (гомолога антрацена) показано [8], что колебательные частоты иона по сравнению с нейтральной молекулой уменьшаются. Отношение колебательных статсумм молекулы и иона нафталина, рассчитанное нами по данным работы [8], близко к 1 (0.85). Поскольку отношение  $Q^0/Q^+$  антрацена равно 1/2, то можно заключить, что колебательные спектры иона и нейтральной молекулы антрацена совпадают. Представляется интересным применение этой методики к другим многоатомным частицам. Например, при исследовании ионизации радикалов необходимо учитывать, что радикал имеет неспаренный электрон, следовательно, нескомпенсированный спин, поэтому мультиплетность электронного состояния равна 2, если в результате акта ионизации этот неспаренный электрон уходит, образовавшийся ион имеет полностью заполненные связи и мультиплетность его равна 1, таким образом, для радикала  $Q^0/Q^+ = 2$ . Это обстоятельство необходимо учитывать при определении потенциалов ионизации радикалов по температурным зависимостям методом поверхностной ионизации, когда  $\gamma$  близко к  $\varphi$ . Таким образом, применяемая методика дает возможность определять отношения полных статсумм иона и нейтральной частицы.

Авторы выражают благодарность Н.Д. Потехиной и Н.И. Ионову за полезные обсуждения.

### Список литературы

- [1] Блашенков Н.М., Ионов Н.И., Лаврентьев Г.Я. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. В. 7. С. 392-397.
- [2] Зандберг Э.Я., Ионов Н.И. Поверхностная ионизация. М.: Наука, 1969. С. 430.
- [3] Левич В.Г. Курс теоретической физики. М.: Наука, 1969. С. 910.
- [4] Бакулина И.Н., Блашенков Н.М., Ионов Н.И., Лаврентьев Г.Я., Шустров Б.Н. Полевой источник ионов для масс-спектрометра. Авторское свидетельство № 711935. Бюл. № 48. 1987.
- [5] Радциг А.А., Смирнов Б.М. Параметры атомов и атомных ионов. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1986. 344 с.
- [6] Энергии разрыва химических связей. Потенциалы ионизации и сродство к электрону. Ред. Кондратьев В.Н., М.: Наука, 1974. С. 351.
- [7] Peacock T.E., Wilkinson P.T.// Proc. Phys. Soc. 1964. V. 83, P. 525-532.

Физико-технический  
институт им. А.Ф. Иоффе  
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию  
12 декабря 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 4  
06.2  
© 1990

26 февраля 1990 г.

## КРАЙ ПОГЛОЩЕНИЯ ВАРИЗОННЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ $InAs_{1-x}Sb_x$ ( $x \leq 0.54$ )

Н.В. Зотова, А.В. Лосев,  
Б.А. Матвеев, Н.М. Стусь,  
Г.Н. Талалакин, А.С. Филиппенко

В последнее время активно исследуется возможность создания длинноволновых ( $8 < \lambda < 14$  мкм) источников и приемников излучения на основе полупроводниковых твердых растворов  $InAs - InSb$  [1]. Одной из трудностей, существующих при создании таких приборов, является большое несоответствие периодов решеток эпитаксиального слоя и бинарной подложки, что ограничивает область составов, получаемых стандартными методами, например методом ЖФЭ [2].

Возможным способом решения проблемы получения методом ЖФЭ узкозонных слоев  $InAs_{1-x}Sb_x$  ( $0.4 < x < 0.7$ ) является выращивание градиентных слоев в условиях высокой пластичности подложки, когда основная часть напряжений снимается за счет процессов пластической деформации, происходящих в подложке и сопровождающихся ее изгибом [3]. Однако до настоящего времени этот способ для получения градиентных эпитаксиальных слоев (ЭС)  $InA_{1-x}Sb_x$  ( $x > 0.19$ ) не применялся, а исследования оптических свойств градиентных слоев этого твердого раствора, в том числе полученных на пластически деформированных подложках, не проводились.

Цель данной работы состояла в получении и исследовании узкозонных твердых растворов  $InAs_{1-x}Sb_x$  с  $x \leq 0.54$ .

Образцы для исследования получали кристаллизацией из расплава на подложках  $InAs$  (111) размерами  $10 \times 12$  мм<sup>2</sup> при принудительном охлаждении, начиная с  $680-720$  °С. На рис. 1 приведено распределение состава по толщине ЭС (кривые  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $y_1$ ,  $y_2$ ) а также значения ширины запрещенной зоны  $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ , полученные для комнатной температуры по соотношениям из [2] (для составов с  $y \neq 0$  использовались формулы из [4] с учетом температурного смещения  $E_g$ , равного 60 мэВ). В рамках допущения